

17.12.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年12月18日

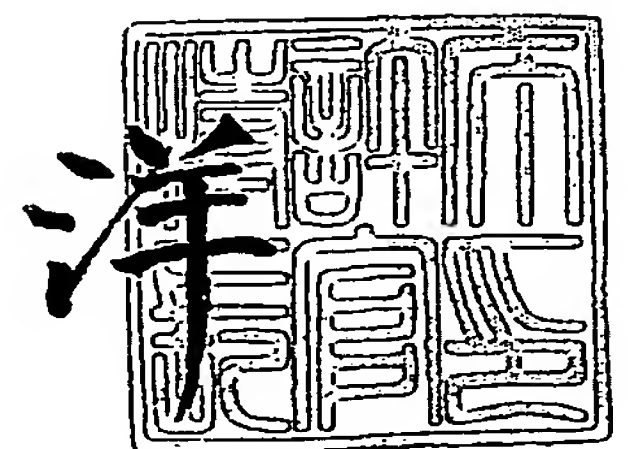
出願番号
Application Number: 特願2003-420885
[ST. 10/C]: [JP2003-420885]

出願人
Applicant(s): 協和発酵ケミカル株式会社

2005年 1月27日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



BEST AVAILABLE COPY

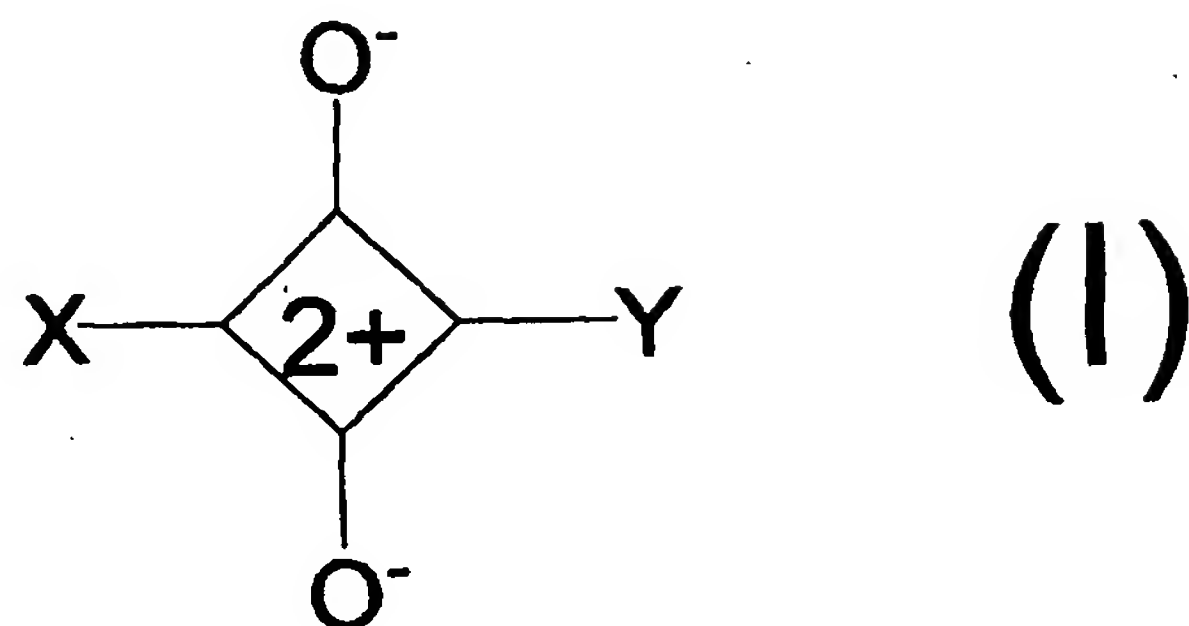
【書類名】 特許願
【整理番号】 H15-241YT3
【提出日】 平成15年12月18日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C09B 57/00
【発明者】
【住所又は居所】 三重県四日市市大協町二丁目 3 番地 協和油化株式会社 四日市
研究所内
【氏名】 清水 幾夫
【発明者】
【住所又は居所】 三重県四日市市大協町二丁目 3 番地 協和油化株式会社 四日市
研究所内
【氏名】 衣笠 元晴
【発明者】
【住所又は居所】 三重県四日市市大協町二丁目 3 番地 協和油化株式会社 四日市
研究所内
【氏名】 鵜飼 勝巳
【特許出願人】
【識別番号】 000162607
【氏名又は名称】 協和油化株式会社
【代表者】 張 將司
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 008419
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

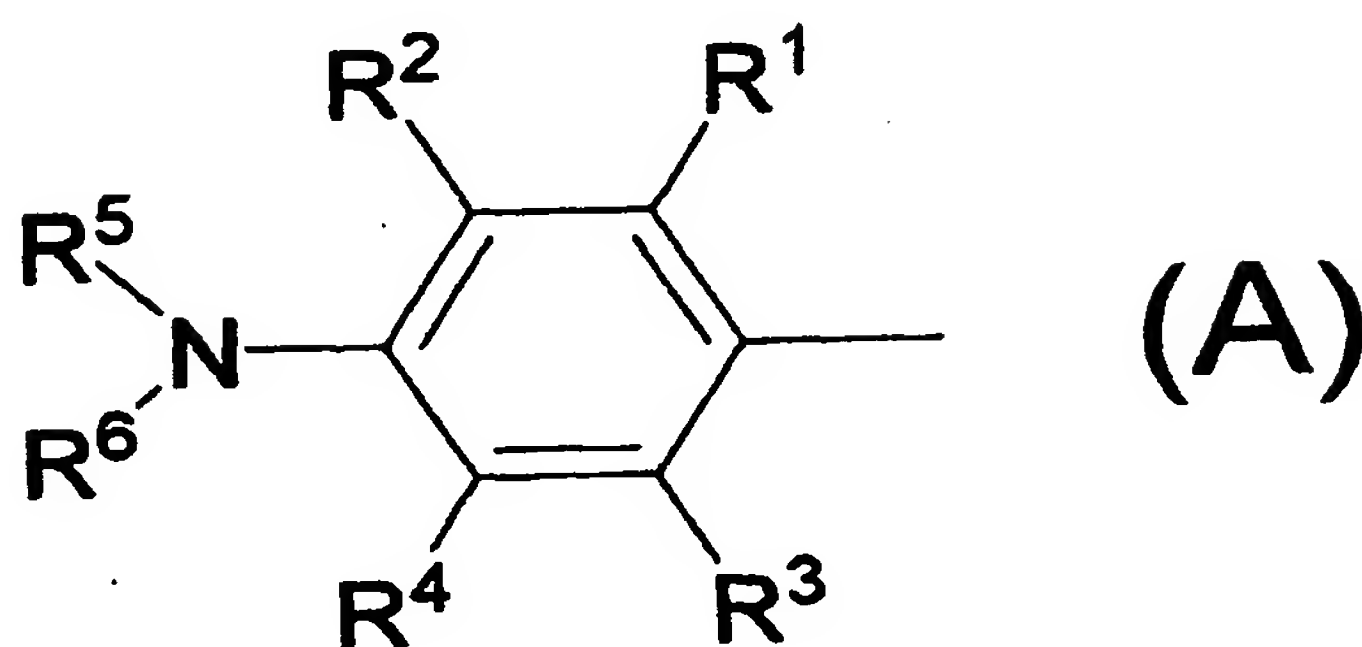
一般式 (I)

【化 1】



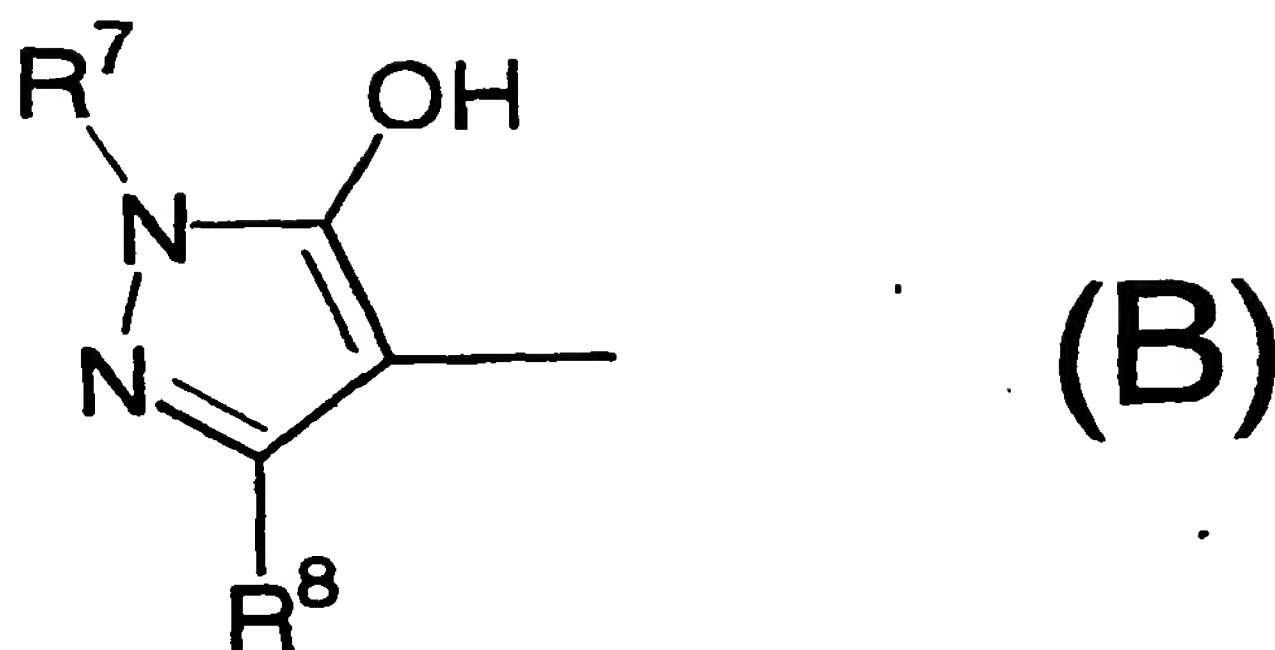
[式中、Xは、以下の式 (A)]

【化 2】



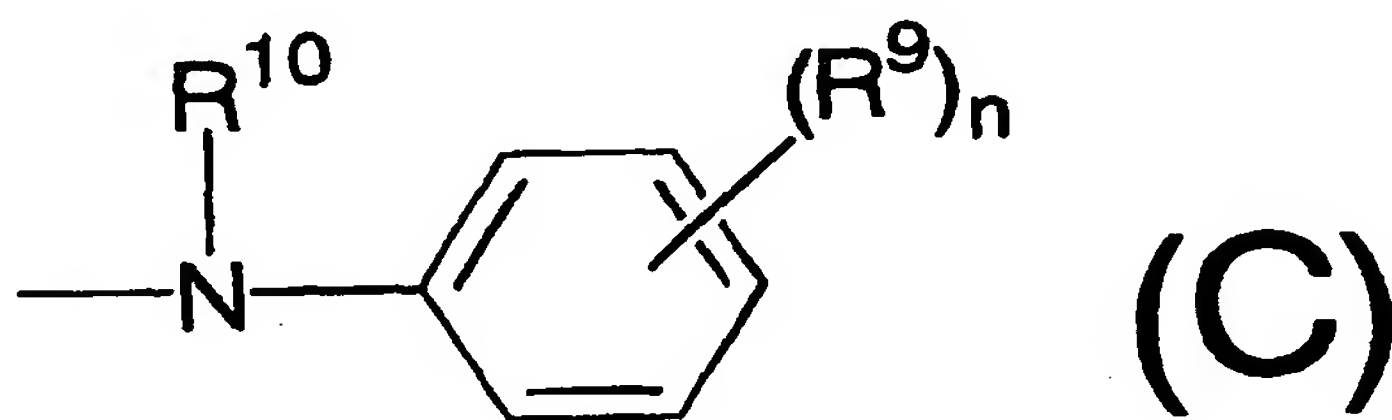
(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシル基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒にあって、置換基を有していてもよい炭化水素環または置換基を有していてもよい複素環を形成してもよく、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 R^5 および R^6 が隣接する窒素原子と一緒にあって置換基を有していてもよい複素環を形成するか、 R^2 および R^5 、または R^4 および R^6 がそれぞれが隣接するN-C-Cと一緒にあって、置換基を有していてもよい複素環を形成してもよい) で表される基または、以下の式 (B)

【化3】



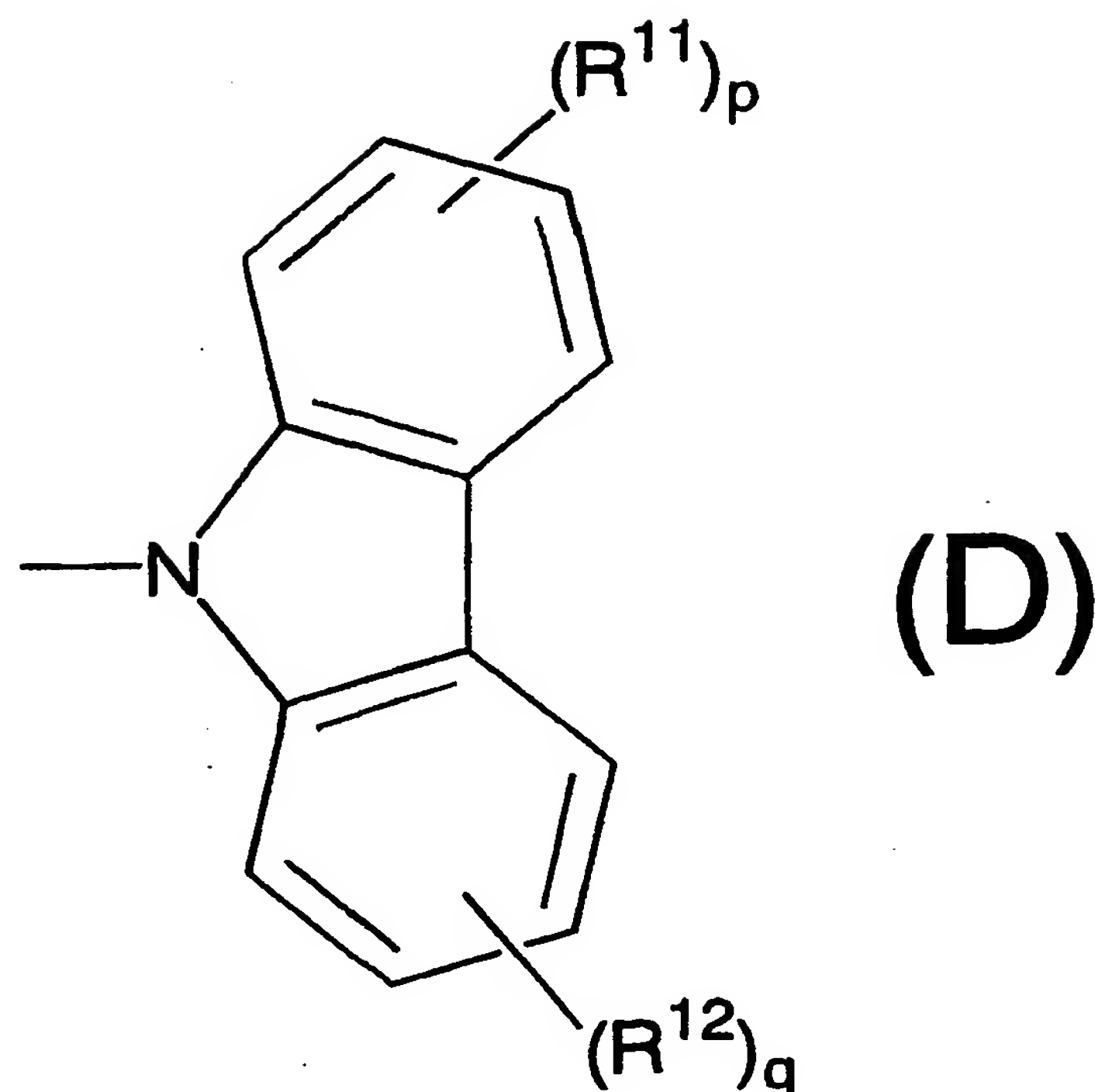
(式中、 R^7 および R^8 は、同一または異なって、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表す) で表される基を表し、Yは、以下の式 (C)

【化4】



(式中、 R^9 は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基、 $-N=N-R^{9A}$ (式中、 R^{9A} は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよい複素環基を表す) または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 n は0~5の整数を表し、ここに、 n が2~5の場合、それぞれの R^9 は、同一または異なってもよく、さらに互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒にあって、置換基を有していてもよい炭化水素環または置換基を有していてもよい複素環を形成してもよく、 R^{10} は、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表す) で表される基または、以下の式 (D)

【化5】

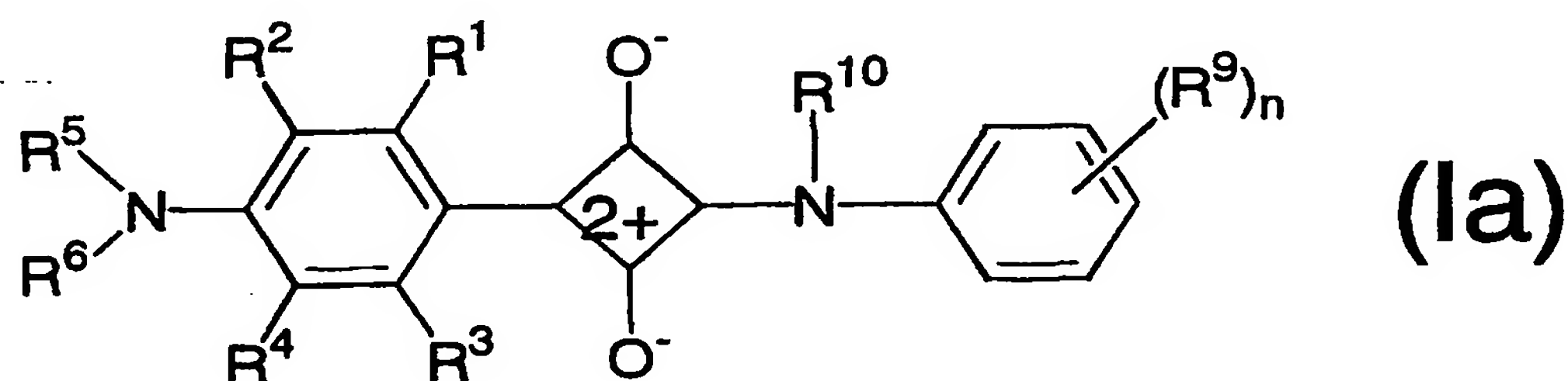


(式中、 R^{11} および R^{12} は、同一または異なって、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 p および q は、同一または異なって、0~4の整数を表し、ここに、 p または q が2~4の場合、それぞれの R^{11} および R^{12} は、同一または異なってもよい) で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

【請求項2】

一般式 (I a)

【化6】

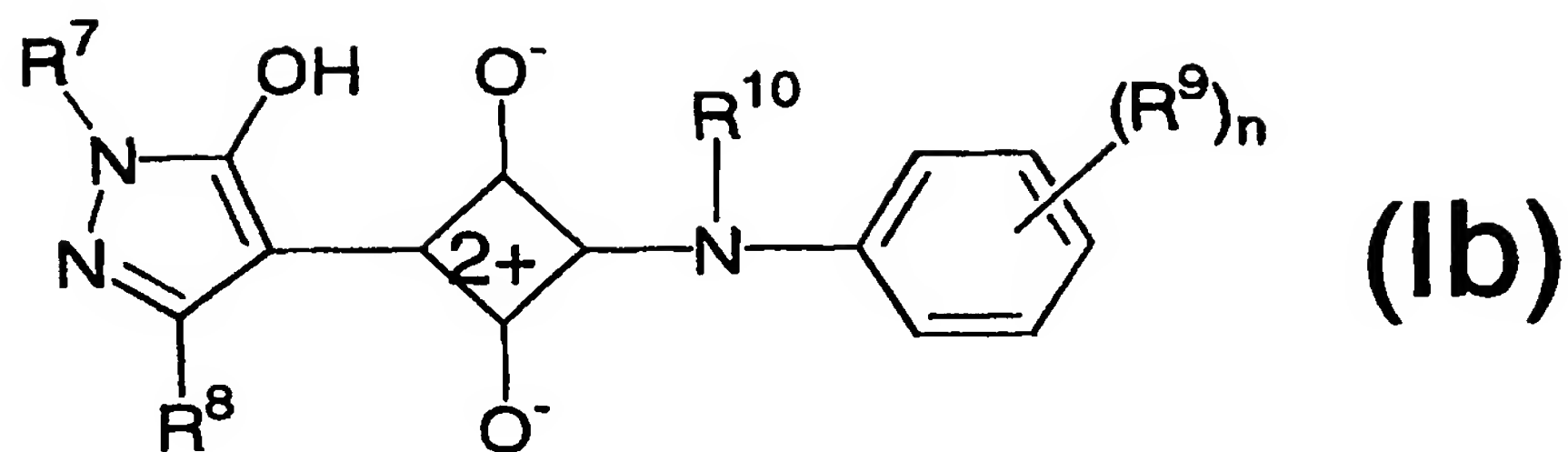


(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

【請求項3】

一般式 (I b)

【化 7】

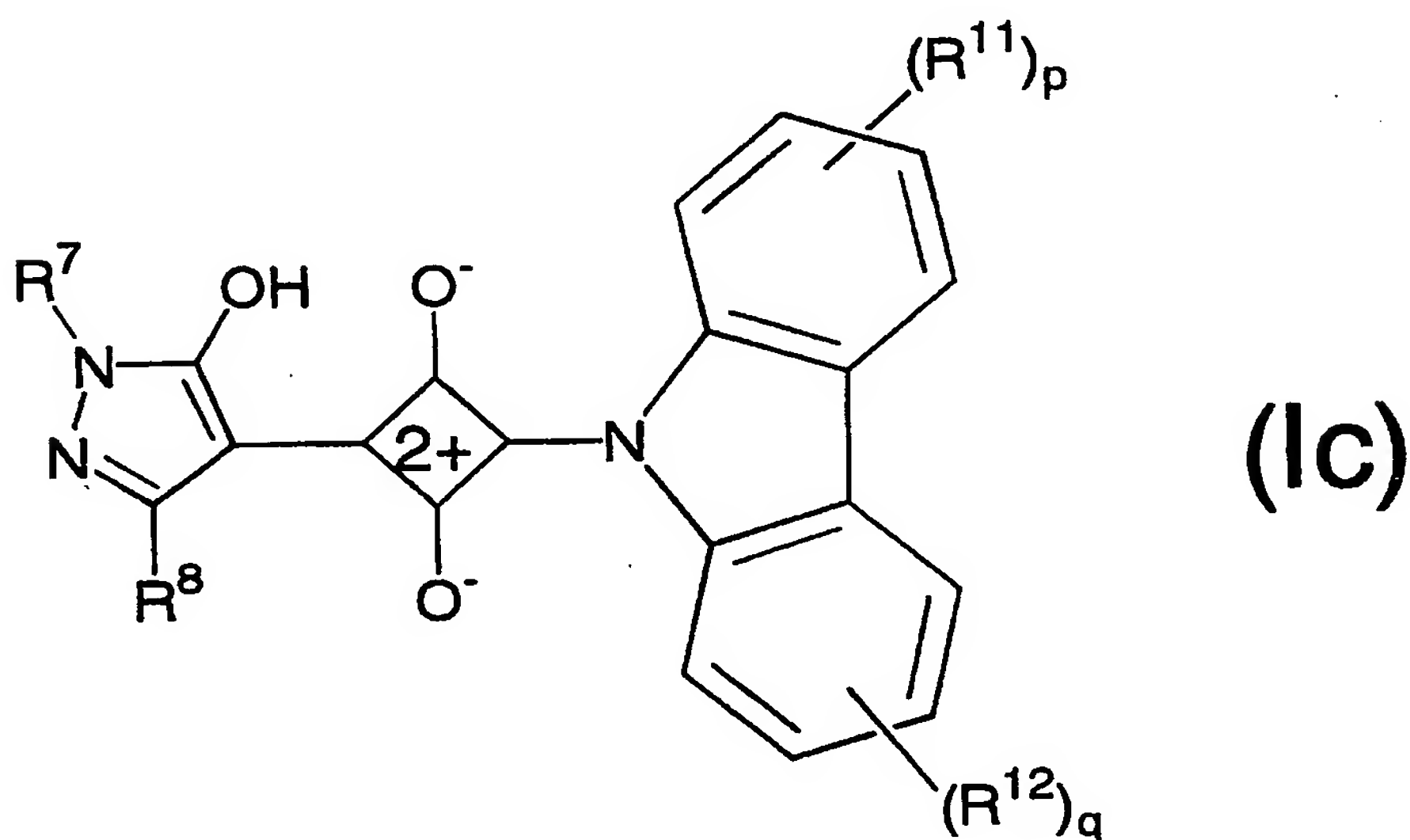


(R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

【請求項 4】

一般式 (I c)

【化 8】

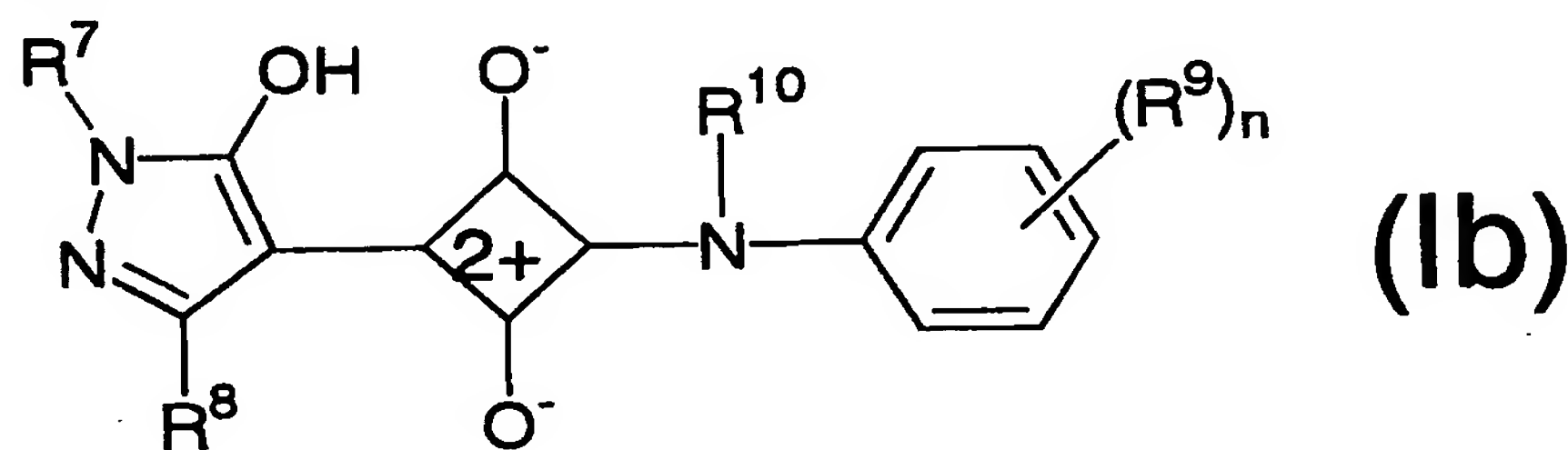


(式中、 R^7 、 R^8 、 R^{11} 、 R^{12} 、 p および q は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

【請求項 5】

一般式 (I b)

【化 9】

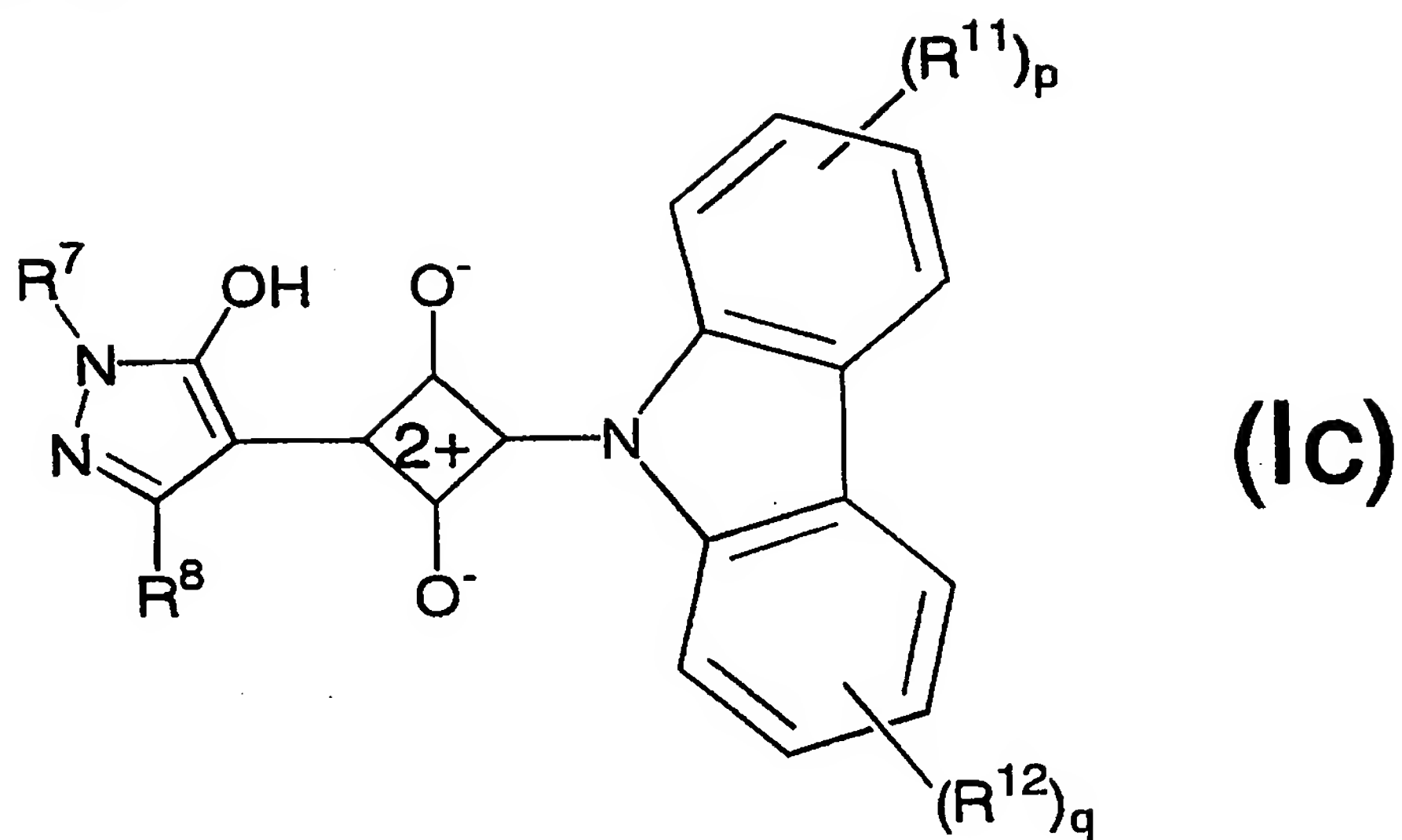


(R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物。

【請求項 6】

一般式 (I c)

【化10】



(式中、 R^7 、 R^8 、 R^{11} 、 R^{12} 、 p および q は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子ディスプレイ装置用フィルター

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子ディスプレイ装置用フィルターに関する。

【背景技術】

【0002】

電子ディスプレイ装置は、理想的には、赤、青、緑の3原色の組み合わせにより、カラー画像を表示する。これまで、より鮮明な色調を有する画像を提供するために、色補正機能を有するフィルターを装備することが考案されている。

色補正機能を有するフィルターに用いられる色調用化合物として、スクアリリウム化合物を使用することが知られている（特許文献1参照）。また、480～520nm前後の光を選択的に遮蔽する電子ディスプレイ装置フィルター用の色素として特定のスクアリリウム化合物を使用することが知られている（特許文献2参照）。

【特許文献1】 特開2000-345059号公報

【特許文献2】 特開2002-97383号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明の目的は、例えば、電子ディスプレイ装置の色調を向上させるため、特定の波長の光を選択的に遮蔽し、鮮明な画像を提供することができる電子ディスプレイ装置用フィルターを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

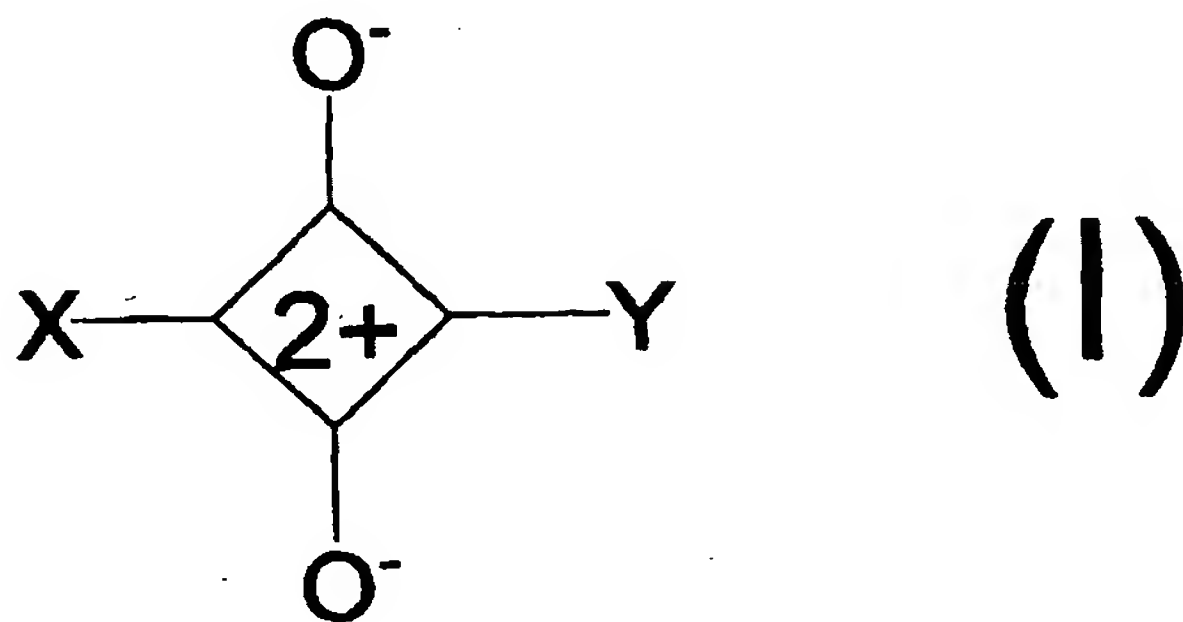
【0004】

本発明は、以下の〔1〕～〔6〕を提供する。

〔1〕 一般式（I）

【0005】

【化11】

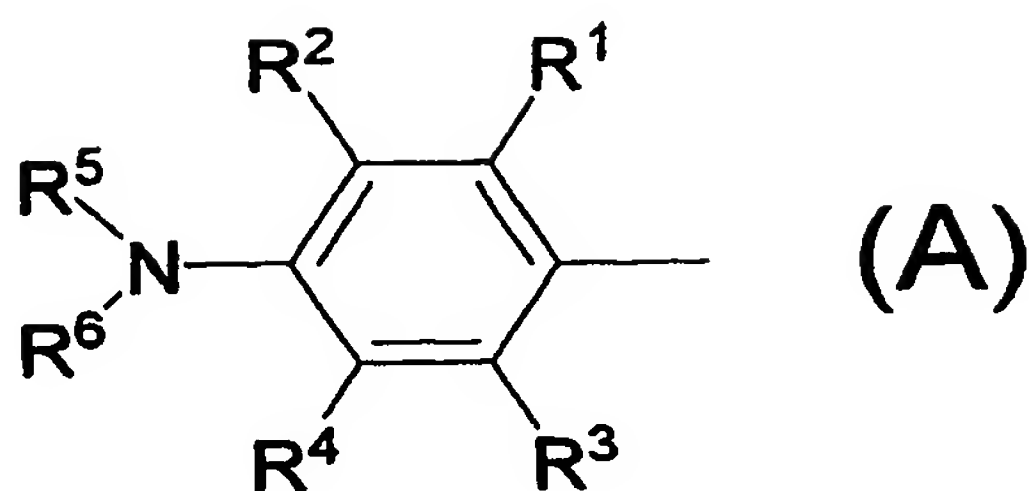


【0006】

〔式中、Xは、以下の式（A）

【0007】

【化12】

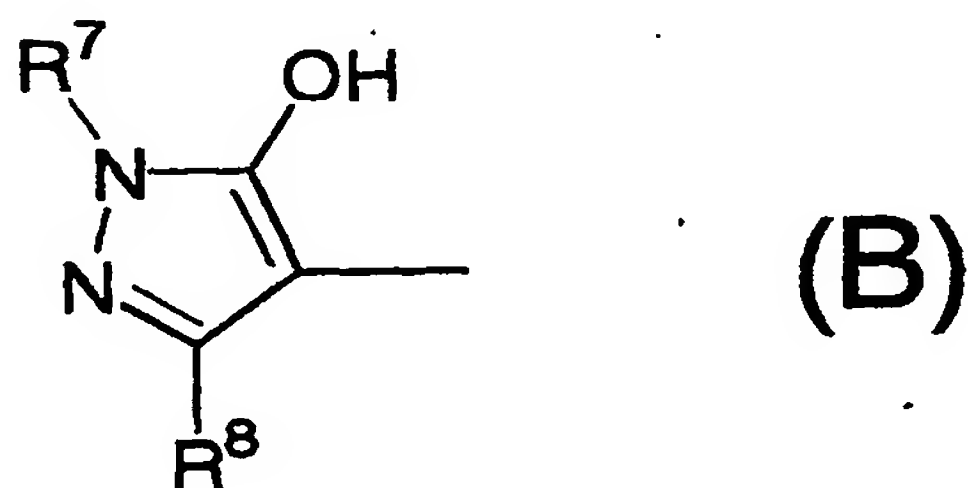


【0008】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒にあって、置換基を有していてもよい炭化水素環または置換基を有していてもよい複素環を形成してもよく、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 R^5 および R^6 が隣接する窒素原子と一緒にあって置換基を有していてもよい複素環を形成するか、 R^2 および R^5 、または R^4 および R^6 がそれぞれが隣接するN-C-Cと一緒にあって、置換基を有していてもよい複素環を形成してもよい)で表される基、または以下の式(B)

【0009】

【化13】

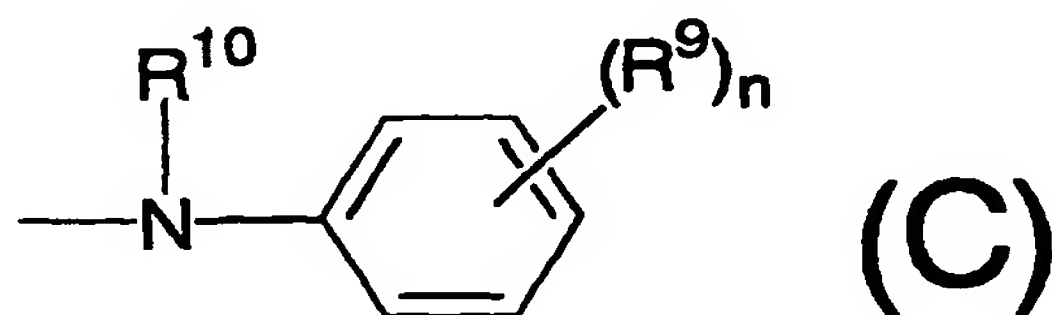


【0010】

(式中、 R^7 および R^8 は、同一または異なって、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表す)で表される基を表し、Yは、以下の式(C)

【0011】

【化14】

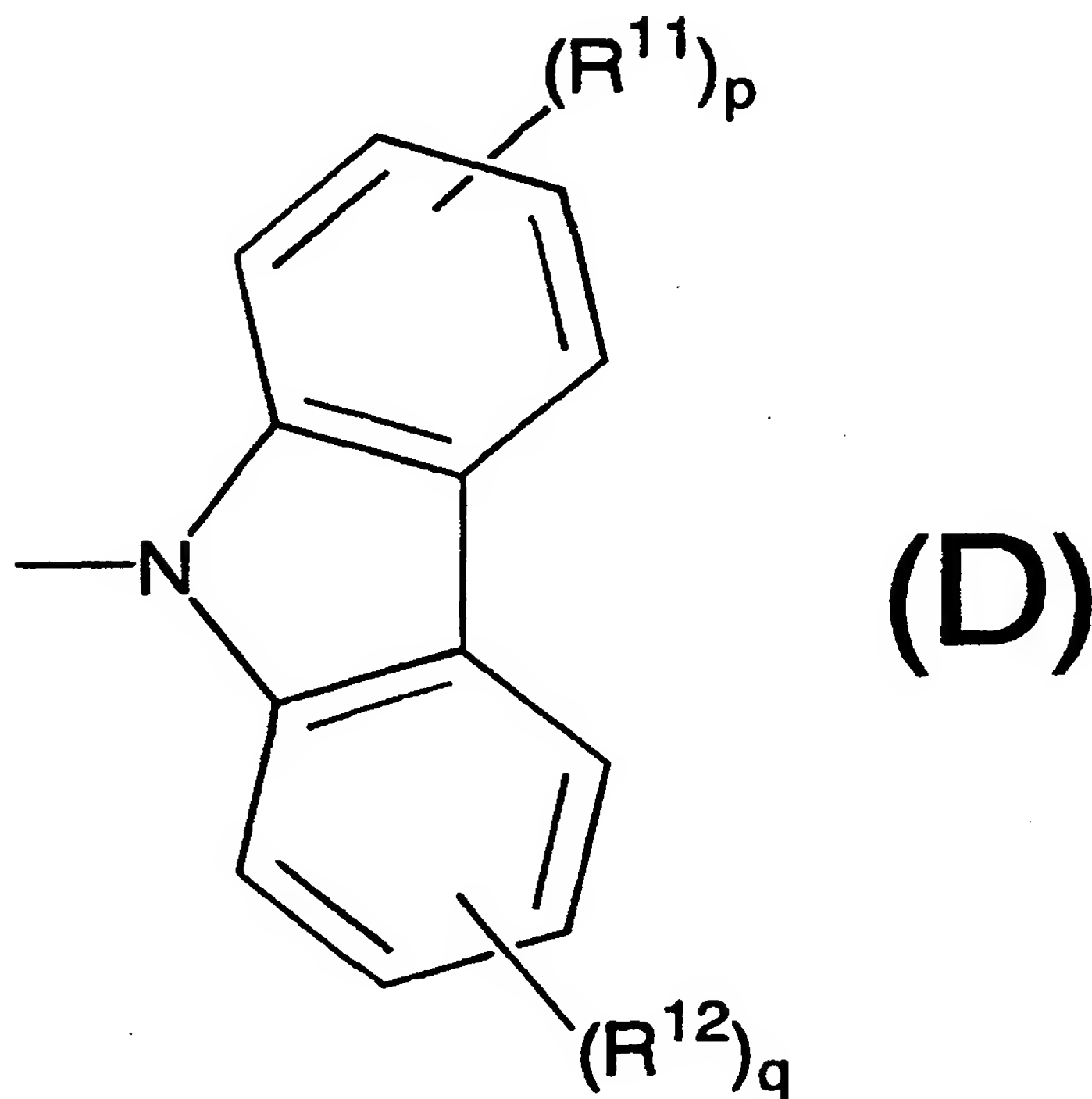


【0012】

(式中、 R^9 は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基、 $-N=N-R^{9A}$ (式中、 R^{9A} は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよい複素環基を表す) または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 n は0~5の整数を表し、ここに、 n が2~5の場合、それぞれの R^9 は、同一または異なってもよく、さらに互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒にあって、置換基を有していてもよい炭化水素環または置換基を有していてもよい複素環を形成してもよく、 R^{10} は、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基を表す) で表される基、または以下の式 (D)

【0013】

【化15】



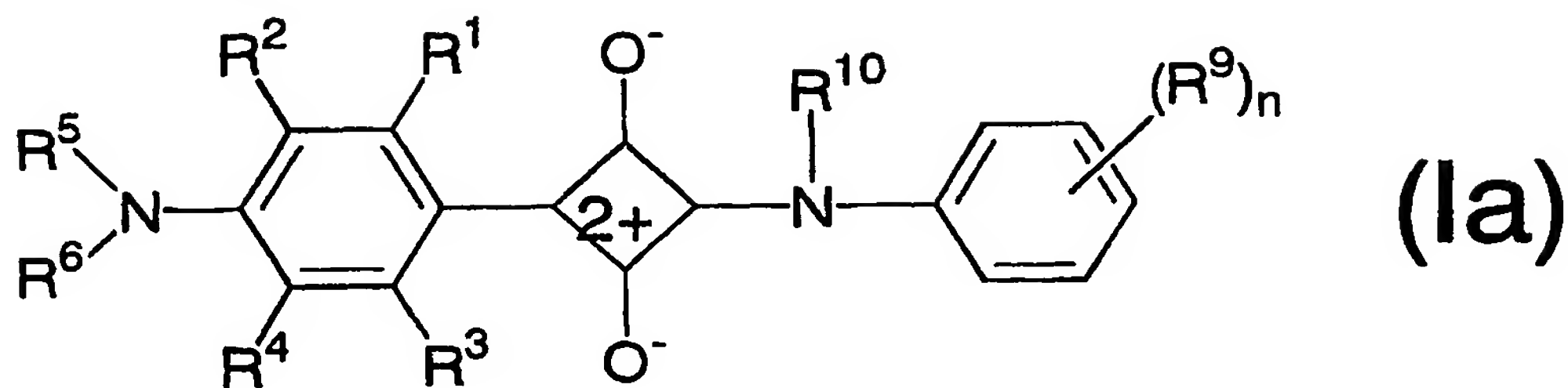
【0014】

(式中、 R^{11} および R^{12} は、同一または異なって、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基または置換基を有していてもよい複素環基を表し、 p および q は、同一または異なって、0~4の整数を表し、ここに、 p または q が2~4の場合、それぞれの R^{11} および R^{12} は、同一または異なってもよい) で表される基を表す] で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

[2] 一般式 (I a)

【0015】

【化16】



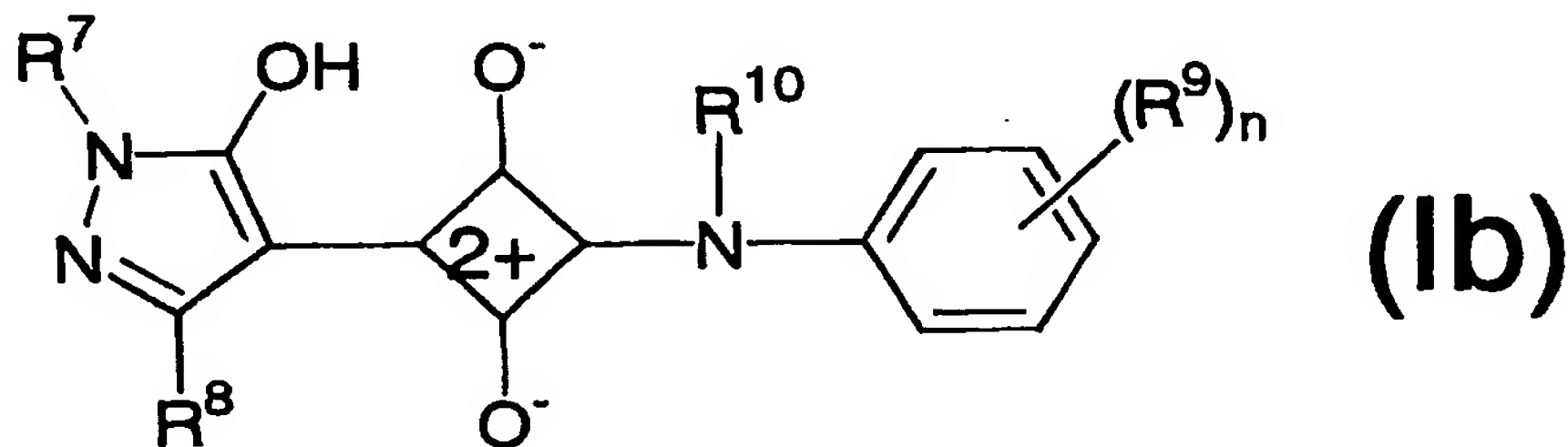
【0016】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

[3] 一般式 (I b)

【0017】

【化17】



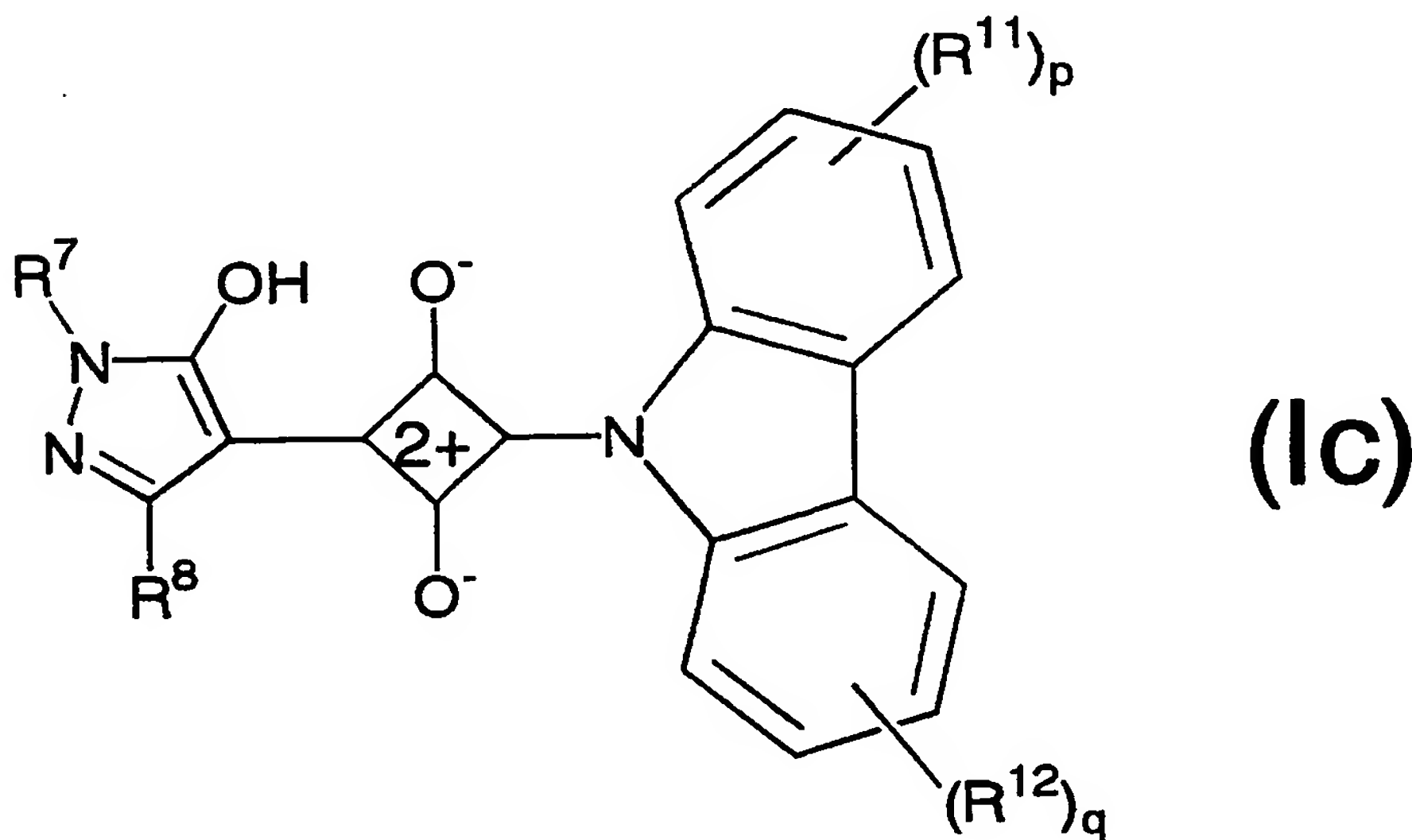
【0018】

(R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

[4] 一般式 (I c)

【0019】

【化18】



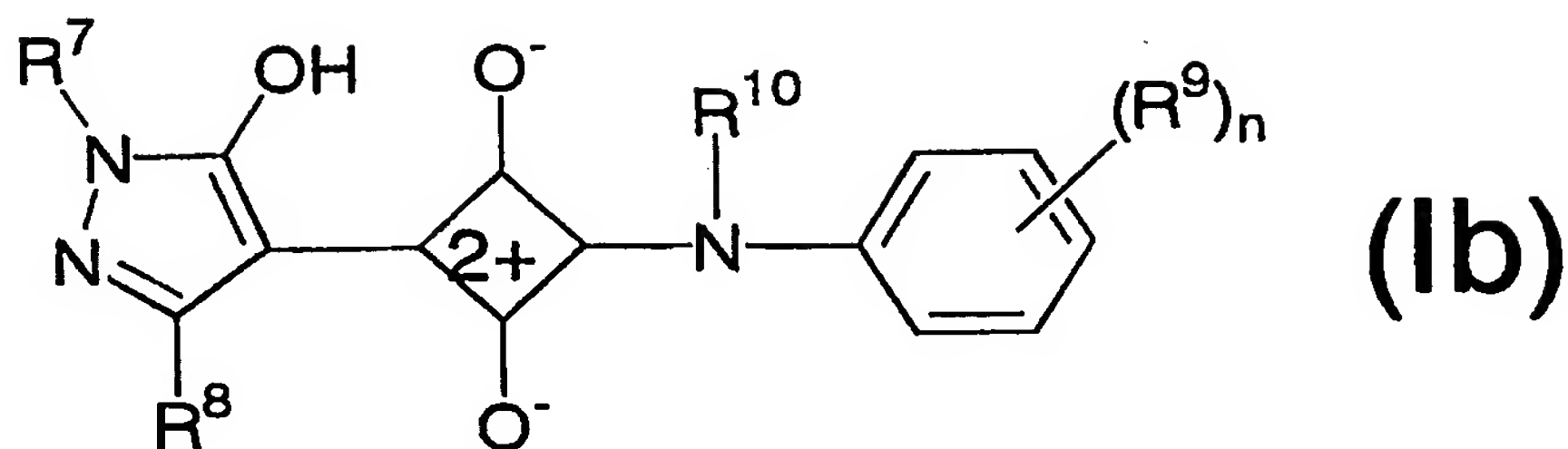
【0020】

(式中、 R^7 、 R^8 、 R^{11} 、 R^{12} 、 p および q は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルター。

[5] 一般式 (I b)

【0021】

【化19】



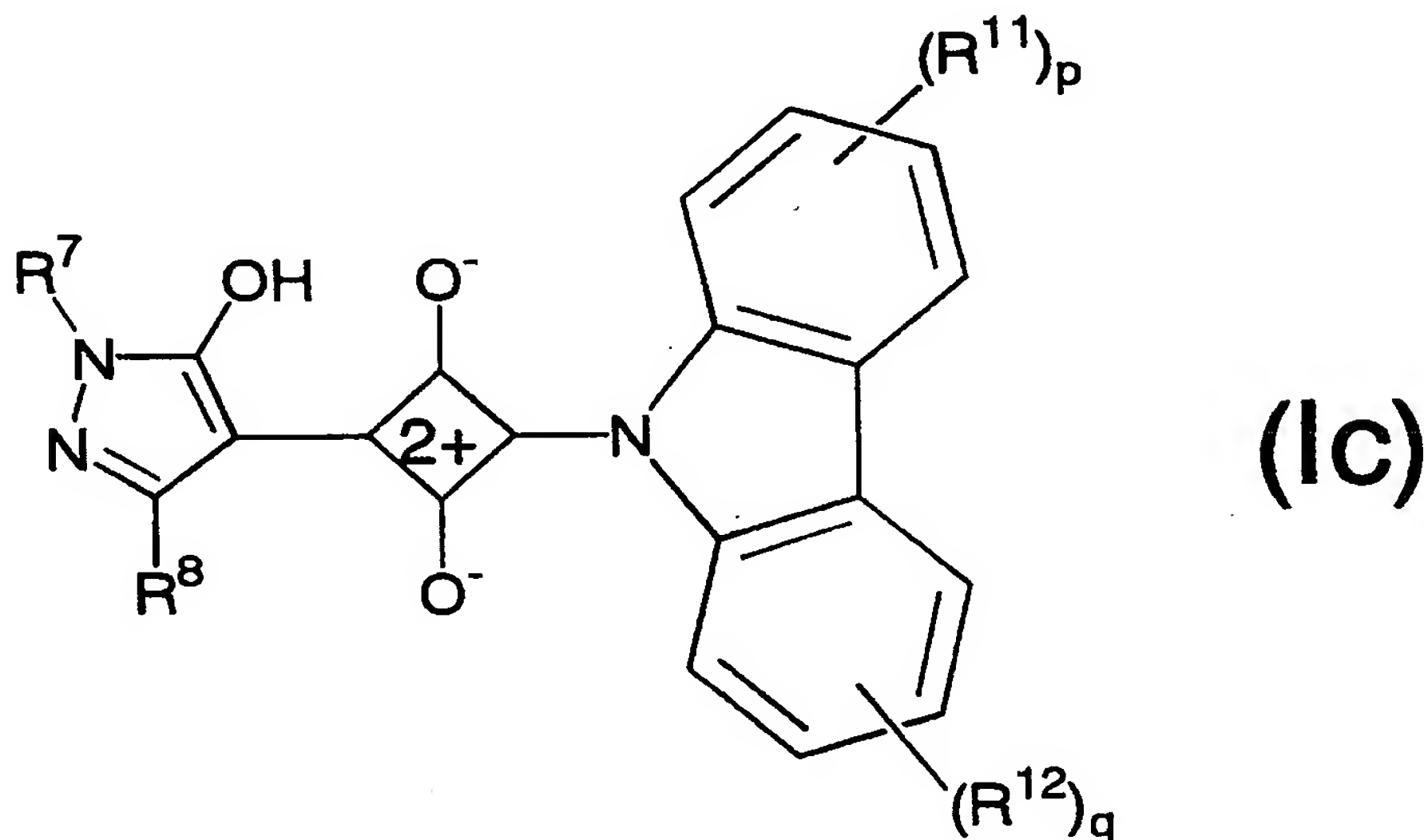
【0022】

(R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および n は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物。

[6] 一般式 (Ic)

【0023】

【化20】



【0024】

(式中、 R^7 、 R^8 、 R^{11} 、 R^{12} 、 p および q は、それぞれ前記と同義である) で表されるスクアリリウム化合物。

【発明の効果】

【0025】

本発明により、例えば、電子ディスプレイ装置の色調を向上させる、特定の波長の光を選択的に遮蔽し、鮮明な画像を提供することができる電子ディスプレイ装置用フィルターを提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0026】

以下、一般式 (I) で表される化合物を化合物 (I) という。他の式番号を付した化合物についても同様に表現する。

一般式の各基の定義において、アルキル基およびアルコキシル基におけるアルキル部分としては、例えば、直鎖もしくは分岐状の炭素数 1～6 のアルキル基または炭素数 3～8 の環状アルキル基があげられ、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、2-メチルブチル基、tert-ペンチル基、ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等があげられる。

【0027】

アラルキル基としては、例えば、炭素数7～15のアラルキル基があげられ、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、ナフチルメチル基等があげられる。

アリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基等があげられる。

【0028】

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子およびヨウ素原子があげられる。

複素環基における複素環としては、芳香族複素環および脂環式複素環があげられる。

芳香族複素環としては、例えば、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む5員または6員の単環性芳香族複素環、3～8員の環が縮合した二環または三環性で窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む縮環性芳香族複素環等があげられ、より具体的にはピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、キノリン環、イソキノリン環、フタラジン環、キナゾリン環、キノキサリン環、ナフチリジン環、シンノリン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、テトラゾール環、チオフェン環、フラン環、チアゾール環、オキサゾール環、インドール環、イソインドール環、インダゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、プリン環、カルバゾール環等があげられる。

【0029】

脂環式複素環としては、例えば、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む5員または6員の単環性脂環式複素環、3～8員の環が縮合した二環または三環性で窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれる少なくとも1個の原子を含む縮環性脂環式複素環等があげられ、より具体的にはピロリジン環、ピペリジン環、ピペラジン環、モルホリン環、チオモルホリン環、ホモピペリジン環、ホモピペラジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロピラン環、ジヒドロベンゾフラン環、テトラヒドロカルバゾール環等があげられる。

【0030】

R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される炭化水素環、ならびに互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される炭化水素環としては、例えば、炭素数5～10の不飽和の炭化水素環があげられ、具体的には、シクロペンテン環、シクロヘキセン環、シクロヘプテン環、シクロオクテン環、ベンゼン環、ナフタレン環等があげられる。

【0031】

R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される複素環ならびに互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される複素環としては、例えば、前記であげた芳香族複素環があげられる。

R^2 および R^5 、または R^4 および R^6 がそれぞれが隣接するN-C-Cと一緒に形成される複素環ならびに R^5 および R^6 が隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環としては、例えば、少なくとも1個の窒素原子を含む5員または6員の単環性複素環（該単環性複素環は、他の窒素原子、酸素原子または硫黄原子を含んでいてもよい）、3～8員の環が縮合した二環または三環性で少なくとも1個の窒素原子を含む縮環性複素環（該縮環性複素環は、他の窒素原子、酸素原子または硫黄原子を含んでいてもよい）等があげられ、より具体的には、ピロリジン環、ピペリジン環、ピペラジン環、モルホリン環、チオモルホリン環、ホモピペリジン環、ホモピペラジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、ピロール環、イミダゾール環、ピラゾール環、インドール環、インドリン環、イソインドール環等があげられる。ただし、

R^2 および R^5 、または R^4 および R^6 がそれぞれが隣接する $N-C-C$ と一緒になって形成される複素環は、少なくとも一つ以上の炭素-炭素間二重結合を環内に含む。

【0032】

アルキル基、およびアルコキシ基の置換基としては、例えば、同一または異なって1～3個の置換基、具体的には、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルコシアルコキシ基等があげられる。ハロゲン原子およびアルコキシ基は、それぞれ前記と同義である。アルコシアルコキシ基の2つのアルコキシ部分は、それぞれ前記と同義である。

【0033】

アラルキル基、アリール基、複素環基、 R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される炭化水素環、互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される炭化水素環、 R^1 および R^2 、または R^3 および R^4 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される複素環、 R^2 および R^5 、または R^4 および R^6 がそれぞれが隣接する $N-C-C$ と一緒になって形成される複素環、 R^5 および R^6 が隣接する窒素原子と一緒に形成される複素環ならびに互いに隣り合う2つの R^9 がそれぞれが隣接する2つの炭素原子と一緒に形成される複素環の置換基としては、例えば、同一または異なって1～5個の置換基、具体的には、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、置換基を有していてもよいアミノ基（アミノ基の置換基としては、例えば、後述するアミノ基の置換基の例示で記載するものがあげられる）等があげられる。ハロゲン原子、アルキル基およびアルコキシ基は、それぞれ前記と同義である。

【0034】

アミノ基の置換基としては、例えば、同一または異なって1または2個の置換基、具体的には、アルキル基、アラルキル基、アリール基等があげられる。アルキル基、アラルキル基およびアリール基は、それぞれ前記と同義である。

化合物 (I) は、公知の方法 (WO 01/44233、WO 01/44375 等) に準じて製造することができる。

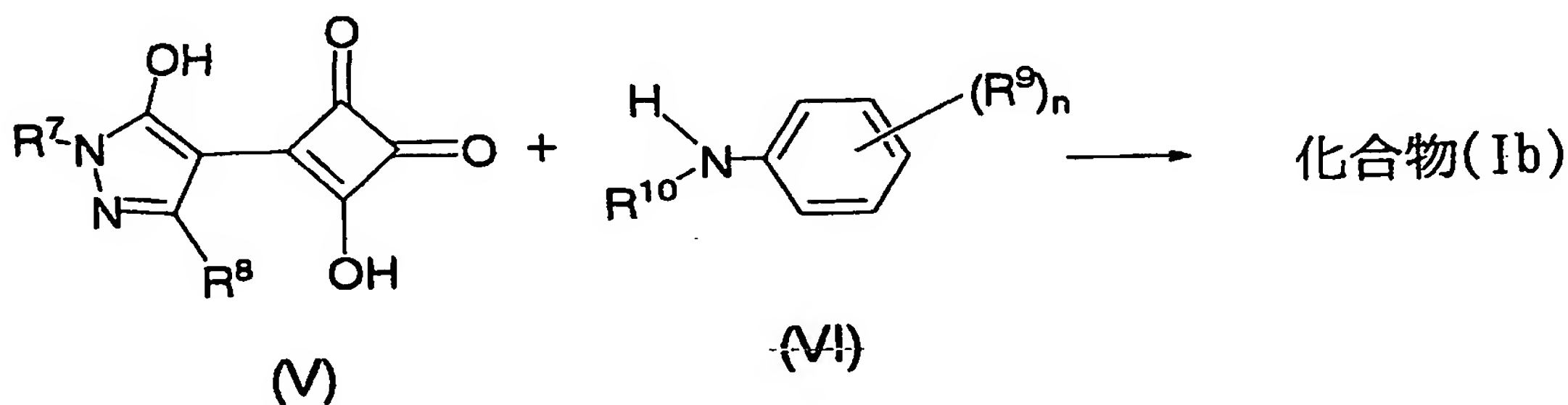
【0035】

例えば、化合物 (I b) および化合物 (I c) については、以下のように製造することができる。

反応式 (1-a)

【0036】

【化21】

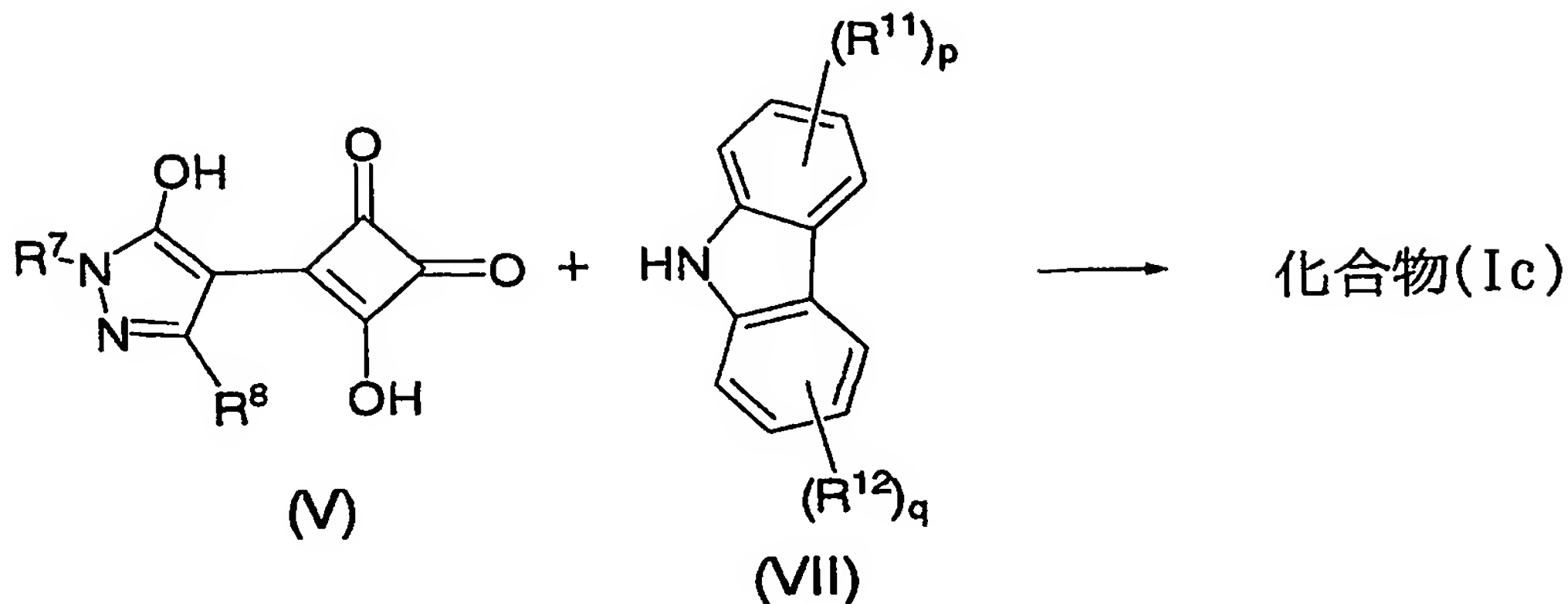


【0037】

反応式 (1-b)

【0038】

【化 22】



【0039】

(式中、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 n 、 p および q は、それぞれ前記と同義である)

反応式 (1-a)

化合物 (V) は、公知の方法 (WO 01/44233 等) に準じて製造することができる。

化合物 (Ib) は、化合物 (V) と 1～5 倍モルの化合物 (VI) とを溶媒中、80～120℃の温度で、1～15 時間反応させることにより得られる。

【0040】

溶媒としては、例えば、例えば、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、オクタノール等のアルコール系溶媒、または該アルコール系溶媒 (50 容量%以上) とベンゼン、トルエンもしくはキシレンとの混合溶媒等が用いられる。

反応後、必要に応じて、目的化合物を有機合成化学で通常用いられる方法 (カラムクロマトグラフィー法、再結晶法または溶媒での洗浄等) で精製してもよい。

反応式 (1-b)

化合物 (Ic) は、化合物 (V) と 1～5 倍モルの化合物 (VII) とを溶媒中、80～120℃の温度で、1～15 時間処理することにより得られる。

【0041】

溶媒としては、例えば、例えば、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、オクタノール等のアルコール系溶媒、または該アルコール系溶媒 (50 容量%以上) とベンゼン、トルエンもしくはキシレンとの混合溶媒等が用いられる。

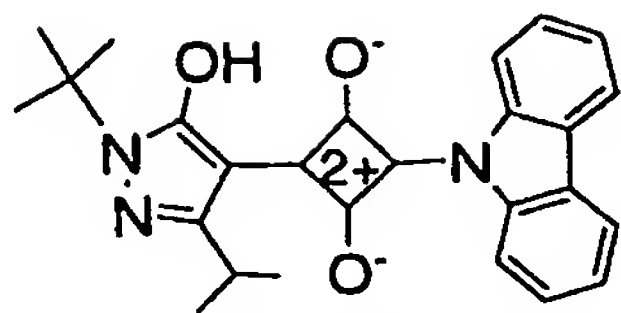
反応後、必要に応じて、目的化合物を有機合成化学で通常用いられる方法 (カラムクロマトグラフィー法、再結晶法または溶媒での洗浄等) で精製してもよい。

【0042】

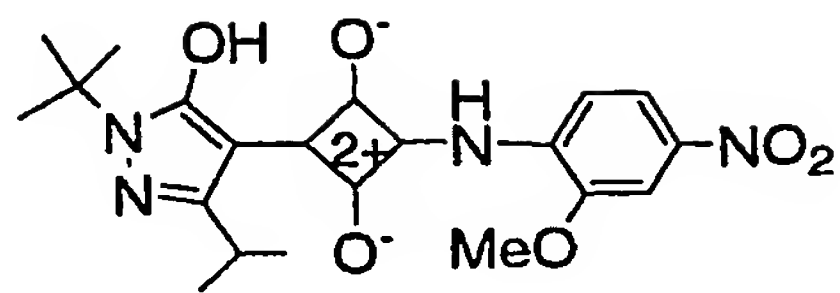
以下に、化合物 (I) の好ましい具体例を記載する。化合物 1～17 の構造式において、Me はメチル基を表し、Et はエチル基を表し、Pr は n-プロピル基を表し、Bu は n-ブチル基を表す。

【0043】

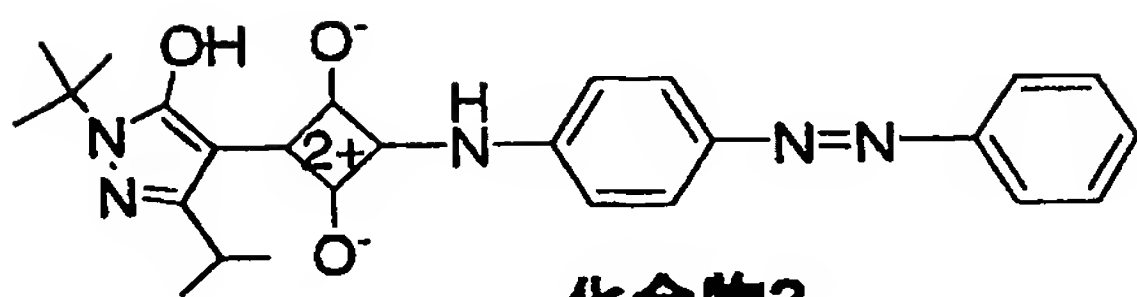
【化23】



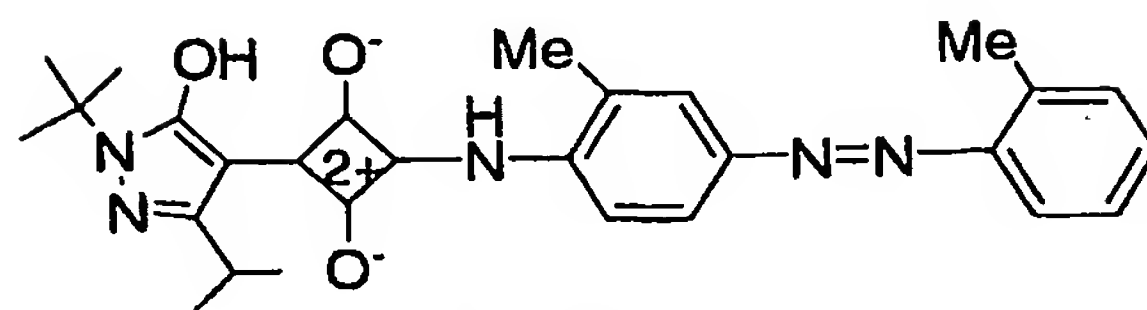
化合物1



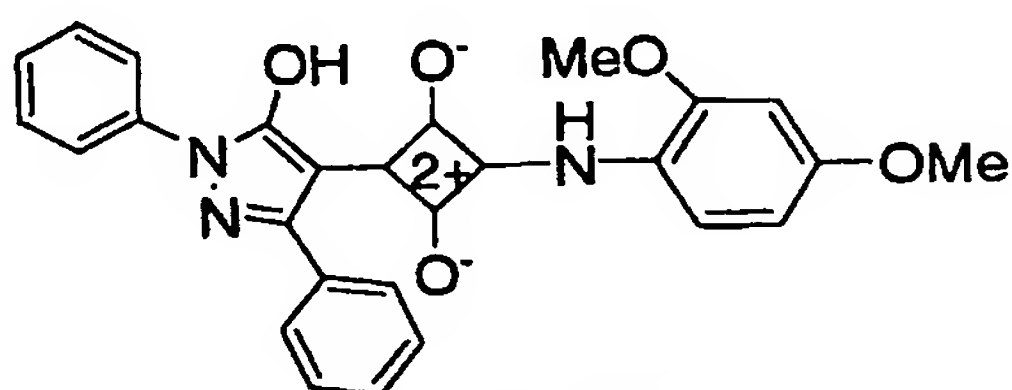
化合物2



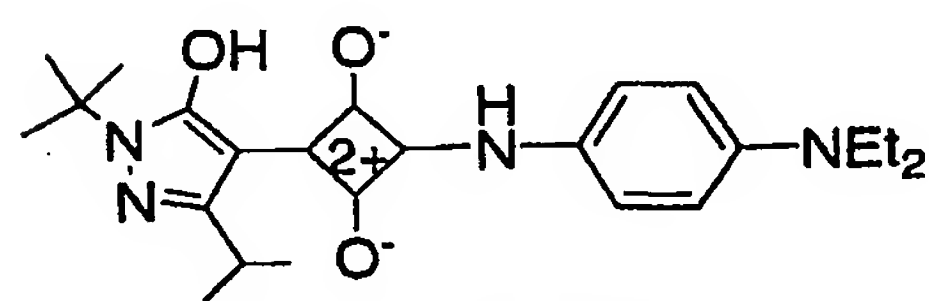
化合物3



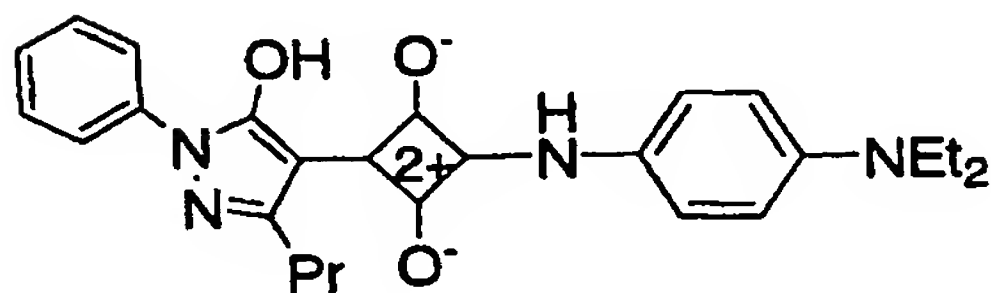
化合物4



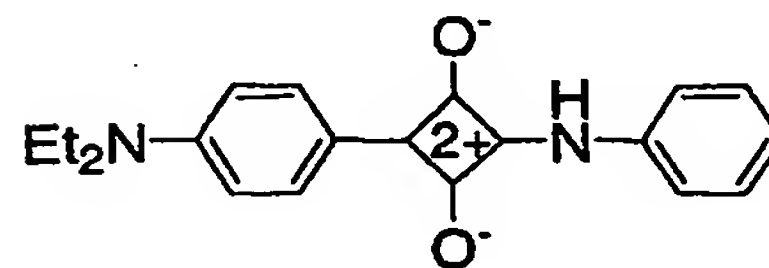
化合物5



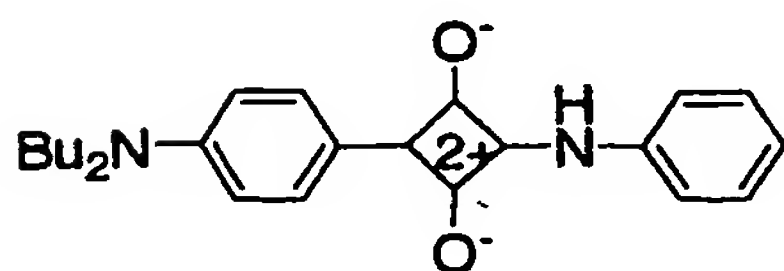
化合物6



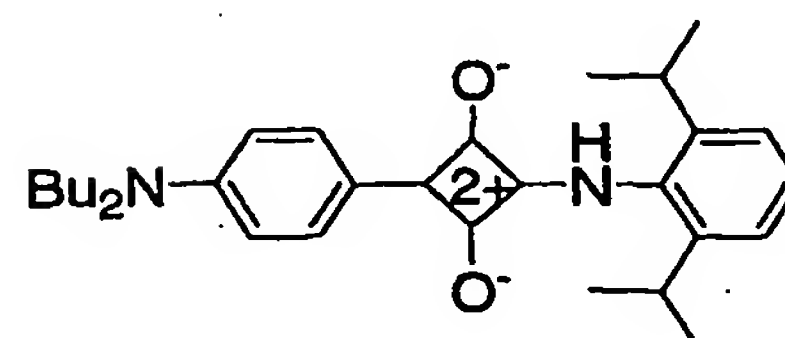
化合物7



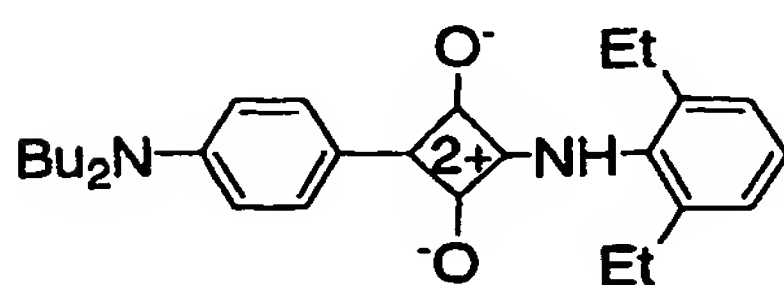
化合物8



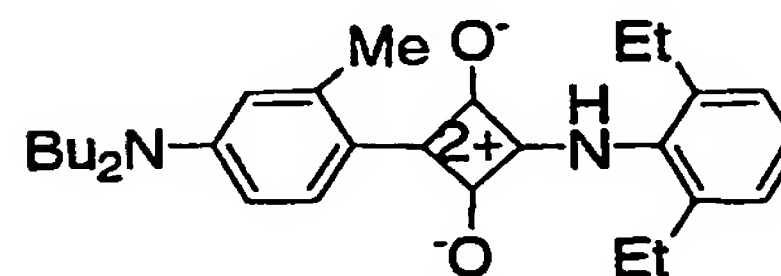
化合物9



化合物10



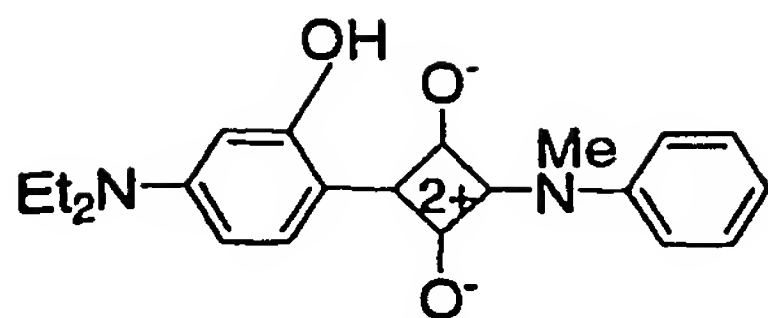
化合物11



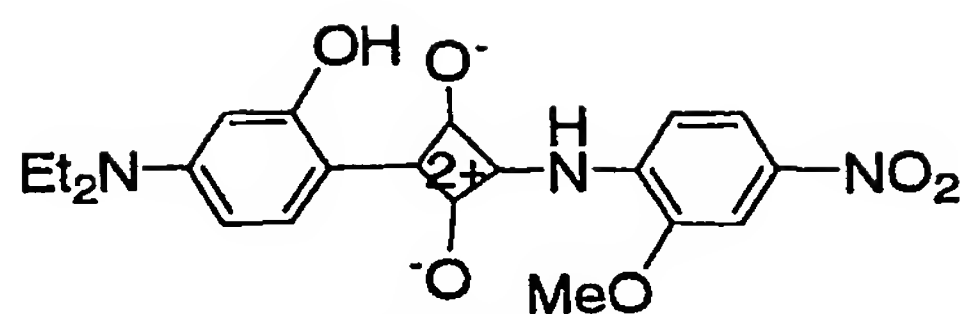
化合物12

【0044】

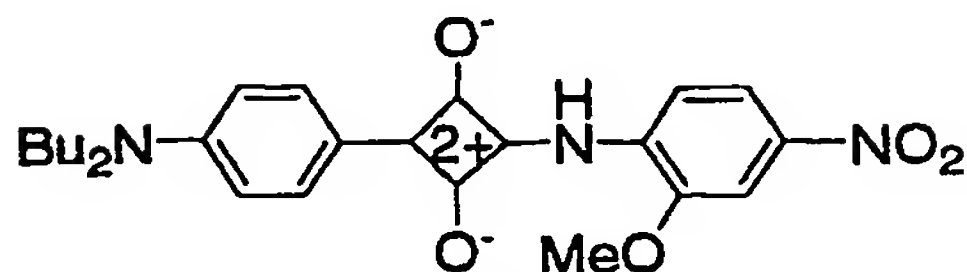
【化 24】



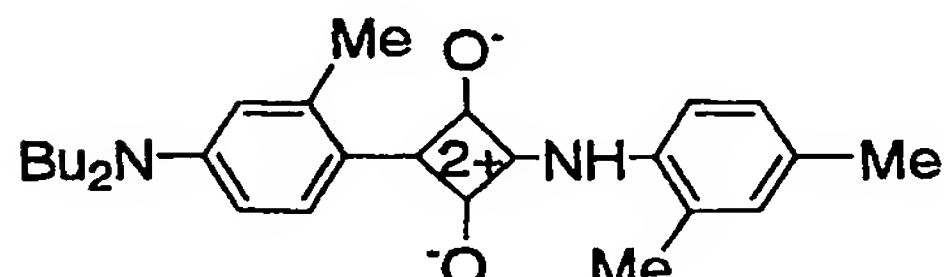
化合物13



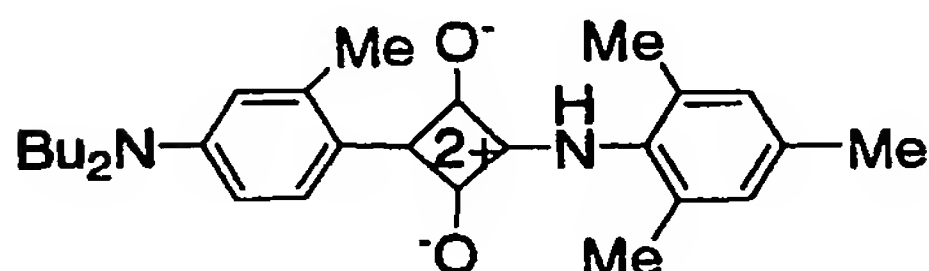
化合物14



化合物15



化合物16



化合物17

【0045】

次に、本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターについて説明する。

電子ディスプレイとしては、例えば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ等があげられ、中でも、プラズマディスプレイ等が好ましい。

本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターに使用される化合物（I）においては、クロホルム溶液中で、450～570 nmの吸収域に吸収極大を有することが好ましい。また、化合物（I）においては、モル吸光係数の対数値が4.5以上であるのが好ましく、4.8以上であるのがより好ましい。化合物（I）は、モル吸光係数が大きいため、本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターに化合物（I）を使用する際、化合物（I）を少量、使用するだけで、十分な性能を出すことができる。

【0046】

本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターにおいては、450～570 nmの吸収域に吸収極大を有することが好ましい。

本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、化合物（I）を含む塗工液を、透明基板に塗布して、有機溶媒を蒸発させて、製造するのが好ましい。また、必要に応じて、さらに他の透明基板を張り合わせてもよい。

【0047】

塗工液は、化合物（I）を含む有機溶媒の溶液をバインダーと共に該有機溶媒に溶解させて調製してもよい。

有機溶媒としては、例えば、ジメトキシエタン、メトキシエトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレン、モノクロロ

ベンゼン等の芳香族炭化水素類等があげられ、化合物 (I) に対して 10~3000 倍量 (重量) 使用されるのが好ましい。

【0048】

バインダーとしては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂等があげられ、化合物 (I) に対して 10~500 倍量 (重量) 使用されるのが好ましい。

透明基板としては、透明で、吸収、散乱が少ない樹脂またはガラスであれば特に限定されないが、例えば、該樹脂としては、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂等があげられる。

【0049】

化合物 (I) を含む塗工液を透明基板に塗布する手法としては、バーコート法、スプレー法、ロールコート法、ディッピング法等の公知の塗布法が利用できる (米国特許 2681294 号等)。

化合物 (I) は、有機溶媒に対する溶解性が高く、前記の塗工液を使用した電子ディスプレイ装置用フィルターの製造法に適している。

【0050】

また、本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、化合物 (I) を透明基板を構成する樹脂に直接溶解、または分散させた後、成形して、フィルム化し、必要に応じて、その片側または両側に他の透明基板を張り合わせて製造してもよい。

化合物 (I) を成形したフィルムにおいては、吸収極大波長近傍での透過率 50% の吸収幅 (吸収極大波長近傍における透過率 50% 以下を示す最大吸収波長と最小吸収波長の差) が、80 nm 以下であることが好ましい。また、化合物 (I) を成形したフィルムにおいては、500~600 nm の領域にて、十分な透過率を有することが好ましく、例えば、450~570 nm の吸収域に吸収極大を有するものに関しては、600 nm での透過率が 80% 以上であることが好ましく、90% 以上であることがより好ましい。

【0051】

本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、視野の明るさを保ちつつ、色純度を低下させる波長の光を選択的に遮蔽し、色補正機能に優れ、色彩に優れた鮮明な画像を提供することができる。

本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、例えば、ブラウン管、蛍光表示管、電界発光パネル、発光ダイオード、プラズマディスプレイパネル、発熱電球、レーザーディスプレイ、液晶ディスプレイまたはエレクトロクロミックディスプレイ等に使用することができる。

【0052】

特に本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、視感度が高い緑の蛍光体の発光強度を調節できる。

以下に、実施例、参考例、試験例により、本発明をさらに具体的に説明する。

【実施例 1】

【0053】

(化合物 1 の製造)

原料である 3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル) シクロブテン-1,2-ジオンは、WO01/44233 記載の方法に準じて合成した。

3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル) シクロブテン-1,2-ジオン 2.00g とカルバゾール 1.60g を、ブタノール 20ml とトルエン 20ml の混合溶媒に入れ、100~110℃ で 12 時間反応させた。その後、反応溶液を 20~30℃ まで冷却し、析出固体を濾取した。取得した固体 1.19g にメタノール 70ml を加え、75℃ で 1 時間攪拌した。その後 20~30℃ まで冷却し、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 1 (0.49g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 1.32(6H, d, $J=6.8\text{Hz}$), 1.64(9H, s), 3.64(1H, m), 7.38(2H, td, $J=7.6\text{Hz}$, 1.2Hz), 7.47(2H, td, $J=7.6\text{Hz}$, 1.2Hz), 7.89(1H, dd, $J=7.6\text{Hz}$, 0.8Hz), 8.92(1H, d, $J=8.4\text{Hz}$).

【実施例 2】

【0054】

(化合物 2 の製造)

3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン1.50gと2-メトキシ-4-ニトロアニリン1.18gを、ブタノール20mlとトルエン20mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。その後、反応溶液を20~30℃まで冷却し、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 2 (1.27 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 1.27(6H, d, $J=6.8\text{Hz}$), 1.59(9H, s), 3.51(1H, m), 4.05(3H, s), 7.79(1H, d, $J=2.4\text{Hz}$), 7.97(1H, dd, $J=8.8\text{Hz}$, 2.4Hz), 8.53(1H, brs).

【実施例 3】

【0055】

(化合物 3 の製造)

3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン2.00gとp-アミノアゾベンゼン1.70gを、ブタノール20mlとトルエン20mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。その後、反応溶液を20~30℃まで冷却し、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 3 (2.46 g) を得た。

【実施例 4】

【0056】

(化合物 4 の製造)

3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン1.0gと4'-アミノ-2,3'-ジメチルアゾベンゼン1.05gを、ブタノール10mlとトルエン10mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で2.5時間反応させた。その後、反応溶液を20~30℃まで冷却し、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 4 (1.26 g) を得た。

【実施例 5】

【0057】

(化合物 5 の製造)

原料である3-ヒドロキシ-4-(5-ヒドロキシ-1,3-ジフェニルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオンは、WO01/44233記載の方法に準じて合成した。

3-ヒドロキシ-4-(5-ヒドロキシ-1,3-ジフェニルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン1.00gと2,4-ジメトキシアニリン0.65gを、ブタノール10mlとトルエン10mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で3.5時間反応させた。その後、反応溶液を20~30℃まで冷却し、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 5 (1.45 g) を得た。

【実施例 6】

【0058】

(化合物 6 の製造)

原料である3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオンは、WO01/44233記載の方法に準じて合成した。

3-ヒドロキシ-4-(1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-イソプロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン0.36gとN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン0.38gを、ブタノール4mlとトルエン4mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。その後、反応溶液を20~30℃まで冷却し、析出した橙色固体を濾

取することにより化合物 6 (0.26 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 1.18(6H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 1.30(6H, d, $J=6.8\text{Hz}$), 1.59(9H, s), 3.38(4H, q, $J=7.2\text{Hz}$), 3.69(1H, m), 6.67(2H, d, $J=9.6\text{Hz}$), 7.77(2H, d, $J=9.6\text{Hz}$), 11.64(1H, brs), 13.73(1H, brs).

【実施例 7】

【0059】

(化合物 7 の製造)

原料である 3-ヒドロキシ-4-(5-ヒドロキシ-1-フェニル-3-プロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオンは、WO 01/44233 記載の方法に準じて合成した。

3-ヒドロキシ-4-(5-ヒドロキシ-1-フェニル-3-プロピルピラゾール-4-イル)シクロブテン-1,2-ジオン 1.50g と N, N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン 1.16g を、ブタノール 20ml と トルエン 20ml の混合溶媒に入れ、100~110℃で 4.5 時間反応させた。その後、反応溶液を 20~30℃まで冷却し、析出した赤色固体を濾取することにより化合物 7 (2.05 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 0.96(3H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 1.09(6H, t, $J=6.8\text{Hz}$), 1.67(2H, m), 2.83(2H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 3.37(4H, q, $J=6.8\text{Hz}$), 6.71(2H, d, $J=9.2\text{Hz}$), 7.32(1H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 7.49(2H, t, $J=8.0\text{Hz}$), 7.64(2H, d, $J=12.8\text{Hz}$), 7.76(2H, d, $J=7.6\text{Hz}$), 12.68(1H, brs).

【参考例 1】 (化合物 8 の製造)

原料である 3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1,2-ジオンは、WO 01/44375 記載の方法に準じて合成した。

【0060】

3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1,2-ジオン 1.18 g と アニリン 0.68g を、ブタノール 20ml と トルエン 10ml の混合溶媒に入れ、100~110℃で 4.0 時間反応させた。その後、反応溶液を 20~30℃まで冷却し、析出した赤紫色固体を濾取することにより化合物 8 (1.45 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 1.15(6H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 3.48(4H, q, $J=7.2\text{Hz}$), 6.84(2H, d, $J=9.2\text{Hz}$), 7.27(1H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 7.46(2H, t, $J=8.0\text{Hz}$), 7.95(2H, dd, $J=8.4\text{Hz}$ and 1.2 Hz), 8.04(2H, d, $J=9.2\text{Hz}$).

【参考例 2】 (化合物 9 の製造)

原料である 3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1,2-ジオンは、WO 01/44375 記載の方法に準じて合成した。

【0061】

3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1,2-ジオン 0.18 g と アニリン 0.07g を、ブタノール 2ml と トルエン 1ml の混合溶媒に入れ、100~110℃で 2.0 時間反応させた。その後、反応溶液を 20~30℃まで冷却し、析出した赤色固体を濾取することにより化合物 9 (0.15 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 0.99(6H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 1.40(4H, m), 1.64(4H, m), 3.39(4H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 6.71(2H, d, $J=9.2\text{Hz}$), 7.25(1H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 7.46(2H, t, $J=7.2\text{Hz}$), 8.20(2H, d, $J=7.6\text{Hz}$), 8.26(2H, d, $J=9.2\text{Hz}$).

【0062】

【参考例 3】 (化合物 10 の製造)

3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1,2-ジオン 0.30g と 2,6-ジイソプロピルアニリン 0.26g を、ブタノール 5ml と トルエン 2.5ml の混合溶媒に入れ、100~110℃で 1.5 時間反応させた。反応溶液を濃縮した後に、メタノール 5ml を加え 65℃で 30 分間攪拌した。0~5℃まで冷却後、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 10 (0.19 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl_3)ppm: 0.94(6H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 1.25(12H, d, $J=6.8\text{Hz}$), 1.34(4H, m), 1.57(4H, m), 3.23(2H, m), 3.32(4H, t, $J=7.6\text{Hz}$), 6.57(2H, d, $J=9.6\text{Hz}$), 7.25(2H, d

, J=5.6Hz), 7.40(1H, t, J=7.6Hz), 8.03(2H, d, J=9.6Hz).

【0063】

[参考例4] (化合物11の製造)

3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジエチルアミノ)フェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン0.28gと2,6-ジエチルアニリン0.18gを、ブタノール4mlとトルエン2mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で1.5時間反応させた。反応溶液を濃縮した後に、メタノール5mlを加え65℃で30分間攪拌した。0~5℃まで冷却後、析出した橙色固体を濾取することにより化合物11 (0.17g)を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl₃)ppm: 0.95(6H, t, J=7.6Hz), 1.24(6H, t, J=7.6Hz), 1.35(4H, m), 1.57(4H, m), 2.76(4H, q, J=7.6Hz), 3.33(4H, t, J=7.6Hz), 6.59(2H, d, J=8.8Hz), 7.20(2H, d, J=8.0Hz), 7.32(1H, dd, J=8.0Hz, 7.2Hz), 8.05(2H, d, J=8.8Hz).

【0064】

[参考例5] (化合物12の製造)

原料である3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジブチルアミノ)-3-メチルフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオンは、WO01/44375記載の方法に準じて合成した。

【0065】

3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジブチルアミノ)-3-メチルフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン0.28gと2,6-ジエチルアニリン0.25gを、ブタノール4mlとトルエン2mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で1時間反応させた。反応溶液を濃縮した後に、メタノール3mlを加え65℃で30分間攪拌した。20~30℃まで冷却後、析出した橙色固体を濾取することにより化合物12 (0.22g)を得た。

$^1\text{H-NMR}$ δ (CDCl₃)ppm: 0.95(6H, t, J=7.6Hz), 1.23(6H, t, J=7.6Hz), 1.34(4H, m), 1.56(4H, m), 2.65(1H, s), 2.76(4H, q, J=7.6Hz), 3.31(4H, t, J=7.6Hz), 6.39(1H, s), 6.41(1H, dd, J=8.8Hz, 2.8Hz), 7.18(2H, d, J=7.6Hz), 7.30(1H, dd, J=8.0Hz, 6.8Hz), 8.42(1H, d, J=8.8Hz).

【0066】

[参考例6] (化合物13の製造)

原料である3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジエチルアミノ)-3-ヒドロキシフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオンは、WO01/44375記載の方法に準じて合成した。

【0067】

3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジエチルアミノ)-3-ヒドロキシフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン0.50gとN-メチルアニリン0.29gを、ブタノール2mlとトルエン2mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。0~5℃まで冷却後、析出した橙色固体を濾取することにより化合物13 (0.57g)を得た。

【0068】

[参考例7] (化合物14の製造)

3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジエチルアミノ)-3-ヒドロキシフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン0.50gと2-メトキシ-4-ニトロアニリン0.42gを、ブタノール2mlとトルエン2mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。室温まで冷却後、析出した灰色固体を濾取することにより化合物14 (0.71g)を得た。

【0069】

[参考例8] (化合物15の製造)

3-ヒドロキシ-4-[4-(N,N-ジエチルアミノ)-3-ヒドロキシフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン0.50gと2-メトキシ-4-ニトロアニリン0.36gを、ブタノール2mlとトルエン2mlの混合溶媒に入れ、100~110℃で5時間反応させた。室温まで冷却後、メタノール2mlを添加し、析出した緑色固体を濾取することにより化合物15 (0.12g)を得た。

【0070】

[参考例 9] (化合物 16 の製造)

原料である 3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジブチルアミノ)-3-メチルフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオンは、WO 01/44375 記載の方法に準じて合成した。

【0071】

3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジブチルアミノ)-3-メチルフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン 0.40g と 2, 4-ジメチルアニリン 0.19g を、ブタノール 5ml とトルエン 2.5ml の混合溶媒に入れ、100~110℃ で 4.5 時間反応させた。反応溶液を濃縮した後に、メタノール 3ml を加え 75℃ で 10 分間攪拌した。0~5℃ まで冷却後、析出した赤褐色固体を濾取することにより化合物 16 (0.39 g) を得た。

【0072】

[参考例 10] (化合物 17 の製造)

3-ヒドロキシ-4-[4-(N, N-ジブチルアミノ)-3-メチルフェニル]シクロブテン-1, 2-ジオン 0.40g と 2, 4, 6-トリメチルアニリン 0.21g を、ブタノール 5ml とトルエン 2.5ml の混合溶媒に入れ、100~110℃ で 2.5 時間反応させた。0~5℃ まで冷却後、析出した橙色固体を濾取することにより化合物 17 (0.22 g) を得た。

【0073】

[試験例 1]

U-4000 型自記分光光度計 [(株) 日立製作所製] を使用し、化合物 1~12 のクロロホルム溶液中での吸収極大波長 (λ_{\max}) とモル吸光係数の対数値 ($\log \epsilon$) を測定 (800~300 nm) した。その結果を表 1 に示す。

【0074】

【表 1】

表 1 スクアリリウム化合物
の分光特性

| 化合物 | 分光特性 (クロホルム溶液) | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| | λ_{\max} (nm) | $\log \epsilon$ |
| 1 | 501.0 | 4.9 |
| 2 | 489.0 | 4.9 |
| 3 | 487.0 | 4.8 |
| 4 | 471.5 | 4.7 |
| 5 | 462.5 | 4.7 |
| 6 | 482.5 | 4.7 |
| 7 | 490.5 | 4.6 |
| 8 | 507.0 | 5.1 |
| 9 | 509.5 | 5.1 |
| 10 | 469.5 | 5.0 |
| 11 | 470.5 | 5.0 |
| 12 | 481.0 | 5.0 |
| 13 | 500.0 | 5.0 |
| 14 | 560.0 | 5.2 |
| 15 | 562.0 | 5.0 |
| 16 | 514.0 | 4.9 |
| 17 | 482.0 | ~ 5.0 |

【実施例 8】

【0075】

化合物 1、2、10、11 または 12 の 1.0 重量% ジメトキシエタン溶液とポリエステル樹脂 [バイロン 200 (東洋紡績 (株) 社製)] の 20 重量% ジメトキシエタン溶液を 7:2 の割合で混合し、ガラス基板上にスピンコーターで塗工、乾燥後、コーティングフィルムを作成した。U-4000 型自記分光光度計 [(株) 日立製作所製] を使用し、このフィルムにおける吸収極大波長、透過率 50% の吸収幅および 600 nm での透過率を測定 (800 ~ 300 nm) した。その結果を表 2 に示す。

【0076】

【表 2】

表 2 スクアリリウム化合物のフィルムにおける吸収極大波長、透過率 50% の吸収幅および 600 nm での透過率

| | 吸収極大 波長 | 透過率50%の 吸収幅 | 600nmでの 透過率 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 化合物 1 | 505.0nm | 71.5nm | 95%以上 |
| 化合物 2 | 496.0nm | 76.0nm | 95%以上 |
| 化合物10 | 474.0nm | 67.5nm | 95%以上 |
| 化合物11 | 475.0nm | 71.5nm | 95%以上 |
| 化合物12 | 486.0nm | 70.0nm | 95%以上 |

【0077】

以上の結果より、本発明の電子ディスプレイ装置用フィルターは、色純度を低下させる波長の光を選択的に遮蔽して、緑色付近の色調を改善し、鮮明な画像を提供できることがわかる。

【産業上の利用可能性】

【0078】

本発明により、例えば、電子ディスプレイ装置用フィルターの色調を向上させる電子ディスプレイ装置用フィルターを提供することができる。

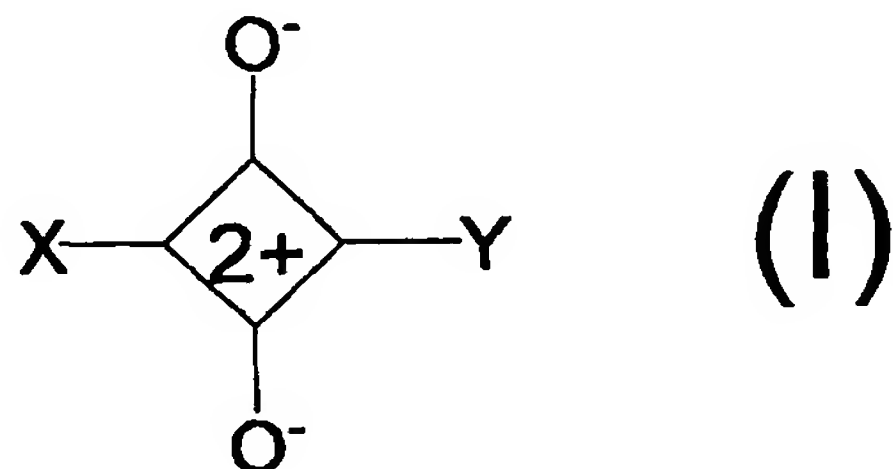
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の目的は、例えば、電子ディスプレイ装置の色調を向上させるため、特定の波長の光を選択的に遮蔽し、鮮明な画像を提供することができる電子ディスプレイ装置用フィルターを提供することにある。

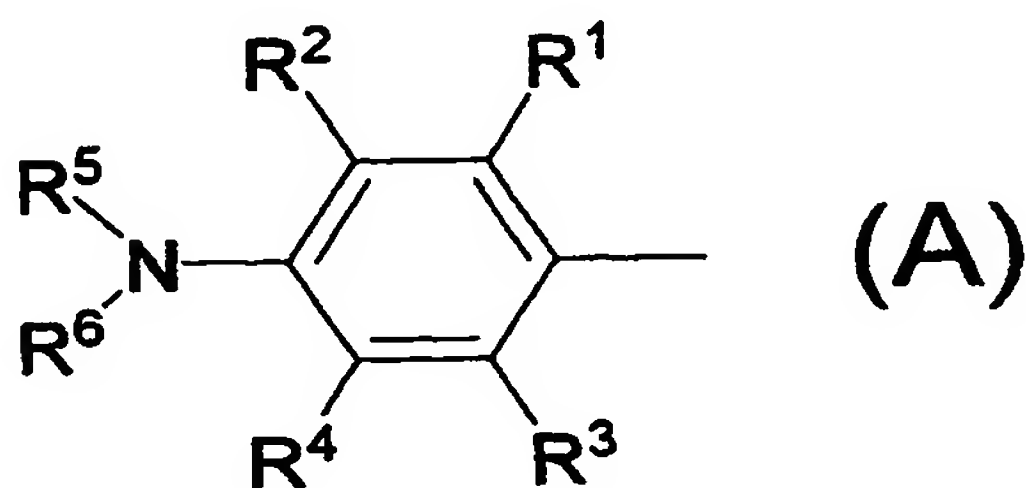
【解決手段】 一般式 (I)

【化 2 4】



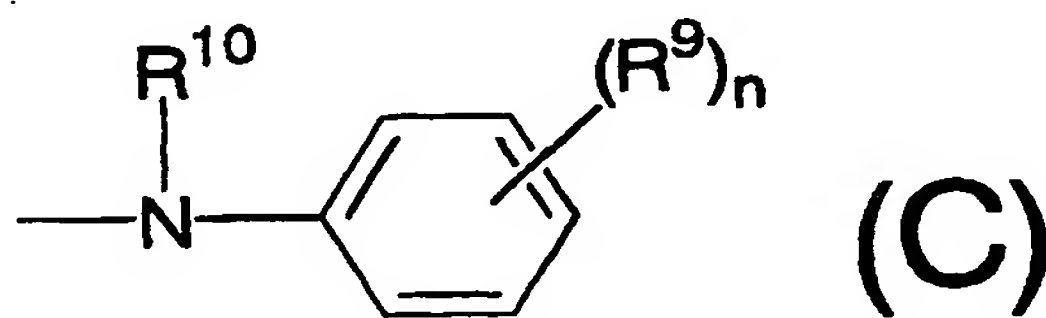
【式中、Xは、以下の式 (A)】

【化 2 5】



(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子等を表し、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基等を表す) で表される基等を表し、Yは、以下の式 (C)

【化 2 6】



(式中、 R^9 は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアルキル基等を表し、 R^{10} は、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基等を表す) で表される基等を表し、nは、0~5の整数を表す] で表されるスクアリリウム化合物を含有する電子ディスプレイ装置用フィルターを提供する。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 4 2 0 8 8 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 6 2 6 0 7]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 6 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号
氏 名 協和油化株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 4 年 5 月 2 8 日
[変更理由] 名称変更
住所変更
住 所 東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 5 号
氏 名 協和発酵ケミカル株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019474

International filing date: 17 December 2004 (17.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-420885
Filing date: 18 December 2003 (18.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse